(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年10月2日(02.10.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/205536 A1

(51) 国際特許分類:
C09D 201/00 (2006.01) *C09D 9/00* (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01) *C09D 201/02* (2006.01)
C09D 5/20 (2006.01) *H01L 21/304* (2006.01)
C09D 7/63 (2018.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/011311

(22) 国際出願日： 2025年3月24日(24.03.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-049742 2024年3月26日(26.03.2024) JP

(71) 出願人: 日産化学株式会社(**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 (JP).

(72) 発明者: 上 林 哲 (**KAMIBAYASHI Satoshi**); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 岸岡 高広(**KISHIOKA Takahiro**); 〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

(74) 代理人: 高岡 亮一, 外 (**TAKAOKA Ryoichi** et al.); 〒1710021 東京都豊島区西池袋５－４－７ 池袋トーセイビル５階 高岡ＩＰ特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：
— 国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2025/205536 A1

(54) **Title:** COMPOSITION FOR FORMING COATING FILM FOR FOREIGN SUBSTANCE REMOVAL, AND SEMICONDUCTOR SUBSTRATE

(54) 発明の名称： 異物除去用コーティング膜形成組成物及び半導体基板

(57) **Abstract:** This composition for forming a coating film for foreign substance removal can form a coating film that can be removed using a remover liquid. The composition contains a film structural component and a solvent, and the film structural component contains a coordination compound.

(57) 要約：除去液によって除去可能なコーティング膜を形成し得る、異物除去用コーティング膜形成組成物であって、 膜構成成分及び溶剤を含み、 前記膜構成成分が、配位性化合物を含む、組成物。